

# 開催案内

## マンスリーセミナー

429 回	2/12 (火)	最先端短波長光源 (DUV/EUV) と 半導体製造への応用	ギガフォトン株式会社 代表取締役副社長 (兼) CTO 溝口 計 氏
<p>(内容) 半導体の微細化の進展とともに光リソグラフィ光源の短波長化が進んできた。KrF、ArF、ArF 液浸、マルチパターンニングと進展し、10 nm 以下のデザイン寸法では EUV(極端紫外線)波長でのリソグラフィが熱望されてきた。近年 EUV 光源の性能改善が進み半導体製造現場での 250W 運転の成功も報告され、ロジックデバイス製造メーカーを中心に EUV 露光装置の導入が大きく進展している。一方でメモリーメーカーでは DUV リソグラフィが主力であり、導入が今なお活発で、DUV 光源の開発も活発に行われている。本講演では、DUV(KrF、ArF 液浸)リソグラフィの進展と DUV エキシマ光源の開発の現状、EUV 光源の昨今の世界での進展と、わが社での開発の現状について解説する。</p>			
430 回	3/18 (火)	ナノ光構造技術と深紫外光デバイス	情報通信研究機構 未来ICT研究所 深紫外光ICTデバイス先端開発センター センター長 井上 振一郎 氏
<p>(内容) 波長 200~300nm で発光する深紫外 LED は、ウィルスの殺菌や飲料水の浄化、水銀ランプの代替、光加工、ICT 応用など、幅広い分野において、その利活用が期待されている。本講演では、近年急速に進展している深紫外 LED デバイスの最新状況や技術課題を概観するとともに、光取出し効率を向上させるナノ光構造技術の中核とした我々の深紫外 LED の高出力化に向けた取組みについて述べる。また深紫外光通信応用や、ナノ光デバイスによる深紫外光波制御などの最新技術、今後の展望などについても紹介する。</p>			

最新情報は光産業技術振興協会のマンスリーセミナーのページをご覧ください。

会 場：光産業技術振興協会 (有楽町線 江戸川橋駅 3 番出口)  
東京都文京区関口 1-20-10 住友江戸川橋駅前ビル 7 階  
時 間：午後 3 時 30 分~5 時 30 分  
定 員：60 名 (申込先着順)  
<http://www.oitda.or.jp/main/monthly-j.html>

参加料：協会賛助会員：1,500 円 (1 回につき・消費税込)  
一般参加：3,000 円 (1 回につき・消費税込)  
大学・公的機関：無料 (学生・院生含む)  
申 込 先：光産業技術振興協会 開発部 村谷  
TEL：(03)5225-6431 FAX：(03)5225-6435  
E-mail：mly@oitda.or.jp